

第 29 回コロイド・界面技術者フォーラム ～コロイド領域の製剤化技術と基盤研究～

CONCEPT コロイド・界面技術者フォーラムでは、第一線でご活躍されている先生をお招きし、じっくり話を伺う機会を提供しています。本年は、コロイド・界面化学分野の最新の製剤化技術と基礎理論に触れることで、コロイド・界面現象を深く理解する場をオンライン開催にて提供します。企業・大学・公共研究機関に所属する研究員が密に語り合い刺激し合える場を設けることで、視野の拡大・研究意欲の鼓舞・研究者ネットワーク形成等に貢献します。

会 期 令和 8 年 12 月 18 日(金) オンライン開催

SESSION 1 講演

13:00-15:10 企業講師3名、アカデミア講師2名によるコロイド・界面現象に関する製剤化技術と基礎研究の紹介

13:05-13:30

分子シミュレーションと機械学習を活用した 界面活性剤水溶液の構造・物性予測

慶應義塾大学

理工学部 機械工学科

荒井 規允氏

界面活性剤を代表とするソフトマター材料について、分子集合構造と物性・機能の関係を粗視化分子シミュレーションと機械学習により解析・予測する研究を紹介する。多成分処方自己集合、洗浄性能評価、臨界充填パラメータ等に基づく構造予測の事例を通じ、実験と計算をつなぐ in silico 材料設計の可能性について講演する。



13:30-13:55

界面吸着から機能発現へ ～ピッカリングエマルションの基礎と化粧品実装～

ポーラ化成工業株式会社

テクニカルディベロップメントセンター

中谷 明弘氏

本講演では、固体微粒子が油水界面を安定化する原理を、接触角・吸着エネルギー・粒子表面設計の観点から整理し、処方・プロセス因子との関係を解説する。さらに、海水で機能が高まるサンスクリーン、二次付着を抑えるファンデーションを題材に、ピッカリングエマルションが化粧品価値へ展開された開発事例を紹介します



13:55-14:20

粒子分散液の塗布乾燥過程 における塗布膜中の粒子挙動 株式会社資生堂 みらい開発研究所 長谷川 克行氏

リキッドファンデーションの仕上がりは主に塗布後の粒子状態の影響を強く受ける。スラリー乾燥の過程で粒子周辺の環境には著しい変化が生じるため、バルクにおける粒子の状態が乾燥塗膜中では必ずしも維持されない。つまり、スラリーから最終的な塗膜状態に至る変化について理解することが重要となる。本講演では粒子分散液の乾燥過程の観察結果および数値シミュレーション結果を元に乾燥中の粒子挙動について説明する。



14:20-14:45

**多孔質セルロースビーズとポリリジンの異なる
SPF ブースト効果のデータサイエンス解析**

MITA 研究所
鈴木 高広氏

化粧品品の紫外線遮蔽剤には、有機吸収剤と無機散乱剤の二種類がありますが、どちらも安全性や使用感に問題があり、少ない配合量で SPF 効果を高める処方技術が求められています。多孔質セルロース粉体とポリリジンの配合効果を調べたところ、異なるメカニズムで紫外線防御剤の分散性が高まることが分かりました。



14:45-15:10

**ポリグリセリン脂肪酸エステルで構成した
ニオソームによる経皮浸透促進が
角層に与える影響**

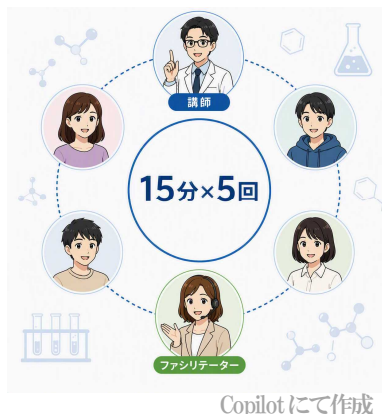
日光ケミカルズ 中央研究所
行方 昌人氏

ポリグリセリン脂肪酸エステル (PGFE) で構成したニオソームの経皮浸透促進効果に注目し、PGFE ニオソームが角層にどう作用するか蛍光イメージング技術を用いて解析した。また、その際の角層の組織学観察や角層下の生細胞層に対する応答性、皮膚バリア機能への影響について評価した。



SESSION 2 ディスカッションタイム

15:25-16:55 5名の講師と順番に対話できる少人数ディスカッション(15分×5回)



●すべての講師と直接交流できます

講師が順番に各グループを回るため、すべての講師と直接話すことができます。専門分野の異なる講師との対話を通じて、幅広い研究テーマや技術に触れることができます。

●少人数ならではの和やかな対話

5～6名程度の少人数グループで進行します。講演会では聞きにくい疑問や研究上の課題についても気軽に質問でき、講師との双方向の対話を通じて理解を深めることができます。

●効率よく幅広い知見を得られます

講師や参加者との交流を通じて、新たな研究テーマや共同研究の着想につながる機会が得られます。専門分野を越えたつながりを広げる場としてもご活用ください。

お申込み・参加費

■お申し込み方法

コロイドおよび界面化学部会 Web サイト(<http://colloid.csj.jp>)にアクセスし、お申込下さい。

※令和8年9月下旬受付開始、申込締切日:令和8年12月上旬 or 定員に達し次第(定員:40名)

■参加費(税込)

部会員 6,000 円 日化・協賛学会員 9,000 円 非会員 11,000 円 学生 3000 円

※ご勤務先が法人部会員の場合は部会員、日本化学会法人会員の場合は日本化学会会員、協賛学会法人会員の場合は協賛学会員扱いとなります。

※協賛学会は、コロイドおよび界面化学部会 Web サイト(<http://colloid.csj.jp>)よりご確認ください。

お問い合わせ

日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 企業委員会

E-mail [tech.kigyo\[at\]colloid.csj.jp](mailto:tech.kigyo@colloid.csj.jp) ※[at]を@に置き換えてください。